

課題番号 : F-17-NU-0020
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : スパッタ法により形成した酸化薄膜の評価
Program Title (English) : Evaluation of oxide film deposited magnetron sputtering
利用者名(日本語) : 鈴木陽香¹⁾, 石川翔太¹⁾, 宇田川洸¹⁾, 三矢晶洋²⁾
Username (English) : H. Suzuki¹⁾, S. Ishikawa¹⁾, K. Udagawa¹⁾, A. Mitsuya²⁾
所属名(日本語) : 1) 名古屋大学大学院工学研究科電子工学専攻, 2) 工学部電気電子情報工学科
Affiliation (English) : 1) Graduate School of Engineering, 2) School of Engineering, Nagoya University
キーワード/Keyword : 成膜・膜堆積、マグネトロンスパッタ、表面ダメージ

1. 概要(Summary)

酸化物ターゲットをスパッタリングすることによって成膜を行う際、高エネルギーの粒子が発生し膜表面へダメージを与えることが問題となっている。本研究では、高エネルギー粒子と薄膜表面の関係について調査を行うことを目的としている。

この課題について名古屋大学の微細加工プラットフォームに技術相談を行ったところ、薄膜表面の評価方法として、原子間力顕微鏡や X 線回折法装置を用いることを提案された。

6. 関連特許(Patent)

なし。

2. 実験(Experimental)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

3. 結果と考察(Results and Discussion)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。